

第11章 平成18年意匠法の一部改正

第1節 平成18年改正の概要

1 背景

1990年代後半から2000年代初頭にかけて、途上国産業の技術、品質、価格面での競争力が強化した中、我が国産業の競争力強化のため、魅力あるデザインにより製品の付加価値を高め、他社の製品との差別化を行うことが重要となっていた。また、企業の経営戦略においては、ブランドの確立が重視され、消費者の嗜好や感性に訴える製品、新しい生活スタイルを提案する製品、使いやすさや環境問題に配慮した製品等の開発に力が入れられ、これらの製品の理念を表現するための手段としてデザイン活動を重視する企業が増加しつつあった。ブランド戦略とデザイン戦略が相互に関連し、相乗効果をもたらす事例も出てきていた。デザインが製品の差別化にとって重要な要素となり、競争力をつけたアジア諸国などからデザイン等を模倣した商品が流入することは、我が国の企業活動にとって障害となっていた。

こうした観点から、新たなデザイン活動の保護や模倣品対策を強化するとともに、産業財産権制度の一層の利便性の向上を図るため、意匠制度を見直す必要があった。^(注1) また、平成15年(2003)に内閣によって「知的財産戦略本部」が設置され、意匠制度を含む知的財産行政全般の大きな見直しを、政府全体でおこなわれようとしていた。このような背景のもと、平成10年の意匠法改正の際に導入された部分意匠制度や関連意匠制度を微調整し、新たな課題(「画像デザイン」、「ダブルトラック制度」、「意匠権の保護対象・効力範囲の拡大」など)を検討する必要があり、意匠制度改正に向けた議論がなされた。

この節では、知的財産の重要性が急速に高まった2000年代初頭から、平成18年(2006)の意匠法の一部改正に至るまでの概要を紹介する。

2 知的財産戦略本部による「知的財産推進計画」

知的財産戦略本部は、知的財産の創造・保護・活用に関する施策を集中的にかつ計画的に推進するために、平成15年(2003)3月1日、内閣総理大臣を本部長として、設置された。^(注2) 平成15年に「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」を発表し、その翌年には「知的財産推進計画2004」を発表、その後毎年、知的財産推進計画を発表している。

知的財産戦略本部が設立される以前、我が国産業の国際競争力の強化、経済の活性化の観点から知的財産の重要性が高まっており、早急に知的財産の戦略を樹立する必要があったため、平成14年(2002)2月25日、知的財産戦略本部の前身に当たる「知的財産戦略会議」の開催が内閣総理大臣により決定された。同年3月20日に開催された第1回の会合から数回の会合を経て、知的財産立国実現に向けた政府の基本的な構想である「知的財産戦略大綱」が同年7月3日に策定された。この大綱に基づく制度改革の一環として、「知的財産戦略本部」の設置・「知的財産戦略計画(仮称)」の策定など

(注1) 参考資料 第5回意匠制度小委員会 資料1「意匠制度の在り方」より抜粋

(注2) 知的財産基本法第24条(設置)「知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的にかつ計画的に推進するため、内閣に、知的財産戦略本部(以下「本部」という。)を置く。」

を内容とする「知的財産基本法」が、国会に上程され、平成 15 年（2003）3 月 1 日に同法施行に至り、これと同日に、知的財産戦略本部が内閣に設置された。^(注3)

知的財産戦略本部が策定した「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」（2003）、「知的財産推進計画 2004」, 「知的財産推進計画 2005」の中で、意匠法改正に向けた検討が要求された。すなわち、「魅力あるデザインを創造して、より価値の高い製品を提供する環境を整備するための具体的方策について意匠制度の在り方を含め検討すること、新たな保護対象（特に、ネットワーク上で利用される操作画面のデザインなど）についても広く検討すること」などが計画書の中で要求された。

3 経済産業省製造産業局デザイン・人間生活システム政策室によるデザイン政策に関する報告

我が国のデザイン政策は、1990 年代に至り急速に役割を縮小していったが、その後、5 年程経過した平成 15 年（2003）当時、再びデザインの戦略的活用の重要性が認識され始めていた。すなわち、戦後 40 年以上にわたって続いた「外国製品の模倣防止対策」としてのデザイン政策が終焉に向かい、代わりに、必要とされているものは「ブランド確立対策」、「産業競争力強化対策」としてのデザイン政策であった。^(注4) このような、時代背景や、2002 年に策定された「知的財産戦略大綱」による「デザイン・ブランドの戦略的活用」の政策に関する検討の要求などを受け、経済産業省製造産業局に「戦略的デザイン活用研究会」が設置された。

「戦略的デザイン活用研究会」は、経済産業省製造産業局デザイン政策チーム（現、デザイン・人間生活システム政策室）により、平成 15 年（2003）2 月 17 日に、青木幸弘 学習院大学教授を座長とし、デザイン・ブランドに関する学識経験者、デザイナー、各業界の有識者から構成される研究会として開催された。

研究会の目的は、国内需要の拡大、製造業の競争力強化に重点を置き、デザインの活用による高付加価値化・差別化を図るためのデザイン政策の在り方について検討することであり、また、知的財産戦略大綱において「優れたデザイン、ブランドの創造支援」、「デザイン・ブランドの戦略的活用」を図るための方策に関する検討が求められていたことが、本研究会立ち上げの一要因であった。

この研究会により「競争力強化に向けた 40 の提言」としてとりまとめられたものが、報告書『デザインはブランド確立への近道ーデザイン政策ルネッサンスー【競争力強化に向けた 40 の提言】』（以下、『40 の提言』という。）として平成 15 年（2003）6 月 10 日に報告されている。この『40 の提言』公表の後、「40 の提言フォローアップ」として、「戦略的デザイン活用研究会 2004」、「戦略的デザイン活用研究会 2005」が開催され、さらに、「40 の提言の見直し」として「戦略的デザイン活用研究会 2006」が開催されている。

『40 の提言』の中での意匠制度に関する言及は、「意匠権の類似の範囲の拡大」、「意匠権の保護対象範囲を画面デザインなどに拡大」、「意匠審査期間の短縮の実現」、「意匠権の利便性の向上のため部分意匠や関連意匠の出願手続の見直し」などであった。

4 知的財産研究所による『特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書』

（財）知的財産研究所は、平成 13 年度（2001）に、「画像デザイン」（主にアイコン）の保護に関する報告書をまとめた。続いて、平成 15 年度（2003）に、「デザインの戦略的活用に即した意匠制度の

^(注3) 知的財産戦略本部の活動は、本稿執筆時の平成 20 年（2008）現在も続いている。

^(注4) 経済産業省製造産業局デザイン政策チーム『戦略的デザイン活用研究会報告』（2003 年）序段「はじめに」より抜粋

在り方」に関する調査研究がおこなわれ、①画面デザインの保護に関する検討、②意匠権の効力範囲の拡大に関する検討、③その他意匠制度の枠組みに関する検討などが報告書としてまとめられた。

そして、意匠制度小委員会開催中である平成 17 年度（2005）に、同委員会における検討の資料とすることを目的に、「独創的なデザインの保護に即した意匠制度にあり方」に関する調査研究がおこなわれた。

5 産業構造審議会知的財産部会 意匠制度小委員会

平成 16 年（2004）7 月、産業構造審議会知的財産部会の下に意匠制度小委員会が設置された。同委員会は、大淵哲也 東京大学法学部教授を委員長として、産業界の有識者、弁理士、学識者などから構成され、全 10 回の会合を開催し、平成 18 年（2006）1 月 25 日に報告書『意匠制度の在り方について』をまとめた。

この報告書によると、知的財産研究所が平成 17 年度（2005）にまとめた『独創的デザインの保護に即した意匠制度のあり方に関する調査研究報告書』の検討項目のうち、「（意匠の範囲を造形思想とするなどの）意匠権の効力範囲の拡大」と「先行意匠開示制度」を除く 13 の検討項目に対しての具体的対応策（改正案）が示されており、「画面デザインへの保護対象の明確化」、「権利期間の延長」、「意匠の類似の範囲の明確化」など 10 項目に関し法改正をおこなう事が適当であると結論付けられた。一方、「税関における部品の取外しへの対応」、「意匠権の物品間の転用までの拡張」、「無審査登録制度の導入によるダブルトラック化」の 3 点に関しては、更なる検討が必要であると報告された。

6 報告書のとりまとめから施行まで

その後、小委員会の上部組織にあたる産業構造審議会第 7 回知的財産政策部会（部会長：中山信弘 東京大学大学院法学政治学研究科教授）が平成 18 年（2006）2 月 15 日に開催され、意匠や特許、商標の制度小委員会の報告書を同部会の報告書とした。翌月、3 月 7 日に「意匠法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、第 164 回通常国会に上程した。そして、平成 18 年（2006）6 月 7 日に平成 18 年法律第 55 号として公布され、主なものは平成 19 年（2007）4 月 1 日に施行されたが、「意匠の新規性喪失の例外の適用の手續見直し」、「団体商標の主体の見直し」は平成 18 年 9 月 1 日に、「輸出の定義規定への追加」、「譲渡等目的所持のみなし侵害規定への追加」、「罰則の見直し」は、平成 19 年 1 月 1 日に施行された。

第 2 節 意匠制度小委員会までの議論

1 知的財産戦略本部

平成 14 年（2002）2 月 25 日から、「知的財産戦略会議」が内閣総理大臣により開催された。同会議が、平成 14 年（2002）7 月 3 日に策定した「知的財産戦略大綱」の中で、意匠制度の在り方について検討し、2005 年度までに結論を得ることが予定されており、これにより平成 18 年の意匠法改正に向けた動きが大きく加速した。また、知的財産戦略本部により、2003 年から毎年「知的財産推進計画」が発表されているが、2003 年、2004 年、2005 年の推進計画の中において、意匠法改正に向けた指針が示されている。

この小節では、これら「大綱」や「計画」の中で、デザイン政策や意匠制度に関わるものを抜粋し

て紹介する。

(1) 知的財産戦略大綱 (2002年7月3日)

- ・ 知的財産立国とは (序章 2. 情報化社会と「知的財産立国」)
「知的財産立国」とは、発明・創作を尊重するという国の方向を明らかにし、ものづくりに加えて、技術、デザイン、ブランドや音楽・映画等のコンテンツといった価値ある「情報づくり」、すなわち無形資産の創造を産業の基盤に据えることにより、我が国経済・社会の再活性化を図るというビジョンに裏打ちされた国家戦略である。」
- ・ デザインの創造支援に関して (第3章 1. 知的財産の創造の促進)
「魅力あるデザインの創造やブランドの構築を促進するため、特許庁の保有するデザイン、ブランド関連情報の活用を促進するための方策について検討し、2003年度末までに成案を得る。(経済産業省)」
- ・ 意匠制度の在り方に関して (第3章 3. 知的財産の活用の促進)
「魅力あるデザインやブランドを活用して、より価値の高い製品・サービスを提供する環境を整備するための具体的方策について、意匠制度、商標制度の在り方を含め検討し、2005年度までに結論を得る。
また、情報化社会の急速な進展を踏まえ、ネットワーク上で利用されるデザインの保護の在り方について早急に検討を行い、2003年度までに結論を得る。(経済産業省)」

(2) 知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画 (2003年7月8日)

- ・ 意匠制度の在り方に関して (第2章 3. 知的財産の保護制度を強化する)
「魅力あるデザインを創造して、より価値の高い製品を提供する環境を整備するための具体的方策について、意匠制度の在り方を含め検討し、2005年度までに結論を得る。」
- ・ 画像デザインに関して (第2章 3. 知的財産の保護制度を強化する)
「ネットワーク上で利用される操作画面(アイコン等)のデザイン等、新たな保護対象についても広く検討を行い、2003年度中に結論を得る。」

(3) 知的財産推進計画2004 (2004年5月27日)

- ・ 意匠制度の在り方に関して (第2章 3. 知的財産の保護制度を強化する)
「2003年度には、ネットワーク上で利用される操作画面(アイコン等)のデザイン保護の在り方について検討した。2004年度においては、魅力あるデザインを創造し、より価値の高い製品を提供する環境を整備するため、意匠制度の全般的な在り方について広範に検討し、2005年度までに結論を得る。」

(4) 知的財産推進計画2005 (2005年6月10日)

- ・ 意匠法改正に関して (第2章 3. 知的財産の保護制度を強化する)
「魅力あるデザインを創造し、より価値の高い製品を提供する環境を整備するため、意匠の定義の見直し、無審査登録制度の導入、類否判断の手法の明確化、関連意匠制度や部分意匠制度の在り方の見直しなどについて2005年度中に検討し、必要に応じ意匠法の改正等制度整備を行う。」

2 経済産業省製造産業局による「戦略的デザイン活用研究会」の報告書（『40の提言』）

「戦略的デザイン活用研究会」の報告書『40の提言』の中で、意匠法改正に関し具体的に言及している項目は、4項目であり、(24)「意匠権の類似の範囲（意匠権の効力の範囲）を拡大」、(25)「意匠権の保護対象範囲の拡大」、(26)「意匠審査期間の短縮の実現」、(27)「意匠権の利便性の向上」に関して、法改正に向けた検討が必要であると提言されている。

そのうち、(24)、(25)、(27)に関しては、法改正の検討がされた。一方、(26)に関しては、業務の機械化や調査員制度の導入などにより審査業務の効率化を図り、また、早期審査制度を導入し、意匠法を改正することなく、課題が実現された。これら意匠制度に関わる項目の概要は以下のとおりである。

(24)意匠権の類似の範囲（意匠権の効力の範囲）を拡大

「効果的に模倣を防ぎ、優れたデザインの創造を奨励するために、意匠権の類似の範囲を拡大」

(25)意匠権の保護対象範囲の拡大

「意匠権の保護対象範囲を画像デザイン等に拡大」

(26)意匠審査期間の短縮の実現

「意匠権について、審査の質を維持することができる範囲で審査期間を短縮」

(27)意匠権の利便性の向上

「意匠権について、部分意匠や関連意匠の出願手続を見直す」

3 知的財産研究所による調査研究

(1) 表示画面上に表示された画像デザインに関する保護についての調査研究委員会（平成13年）

・ 開催の趣旨

情報技術化が進む中、企業は画像デザインの重要性を認識し、その開発に大きな投資をおこなっていた。ところが、当時の意匠法では、画像デザインそのものは保護されず、物品の模様と認められる範囲で限定的に保護されていた。また、著作権や特許法など他の知的財産法でも保護が十分ではなかった。

一方、海外に目をむけてみると、例えば、米国において1988年にアイコンのデザインが意匠特許として初めて登録された後、審決による登録の中断を経て、1996年に米国特許商標庁（USPTO）がアイコンの保護に関するガイドラインを公表し、広範囲にわたる画像デザインが権利化されていた。EUや韓国でも同様に画像デザインの保護の傾向があり、日本と海外との格差が生じていた。

そこで、意匠法を中心として、画像デザインをいかに保護すべきかについて立法的な考察をおこなうため、委員長を茶園成樹 大阪大学大学院法学研究科助教授として、本委員会が開催された。

・ 報告の概要

この報告書『表示画面上に表示された画像デザインに関する保護についての調査研究報告書』では、まず、(1)画像デザインの創作実態、(2)日本における画像デザイン保護の実態、をまとめ、次に、保護の要望と必要性に関し、(3)国内の各団体^(注5)に対するヒアリングをまとめ、(4)国内・海外の調査として、国内企業に対するヒアリングと外国意匠制度の調査をおこない、最後に、(5)意匠法による画像デザインの保護の在り方について提言をおこない、総合的な結論を与えている。

(1)画像デザインの創作実態に関して、創作の現場では画像デザインは独立したデザイン対象と

(注5) 日本知的財産協会、(社)電子情報技術産業協会（JEITA）、日本弁理士会など

して扱われており、また、商品における画像デザインは、既に、他社との差別化と商品特徴を明確にする重要な手段となっていることを踏まえ、創作実態に即せば、画像デザインは機器のデザインとは別に単独で保護対象とすべきである、と指摘している。

(2) 日本の画像デザインの保護の実態に関して、まず、意匠制度における画像デザインの保護の経緯^(注6)がまとめられている。そして、画像デザインが部分意匠の一形態としてある程度の保護が可能となっているが、新しい価値観の下にある画像デザインに関して、従来の枠組み（物品性要件など）ではなく新しい考えに基づく保護の枠組みを構築すべき、と指摘している。続いて、画像デザイン保護における日米格差が指摘され、また、日本の他法域における画像デザインの保護の困難性も指摘している。

(3) 国内の関係団体にヒアリングした結果の要旨は以下のとおりである。

○日本知的財産協会：「画像デザインの本質を実効性のある権利で保護するためには、現行意匠法においては限界がある。更なる保護拡大に向けて法改正等を検討する必要がある。」

○社団法人 電子情報技術産業協会：「今後ますます重要性が増すと考えられる画像デザインの保護については、様々な問題点をクリアして、画像デザインの保護をバランス良く行うことが望まれる。」

○日本弁理士会：「①国際ハーモナイゼーションの観点から、現段階では画像デザインの国際的保護の状態は統一されていないので、国際的なハーモナイゼーションの必要性が生じているとの結論には至らない。また、②画像デザインの保護の必要性と保護の在り方に関しては、当時の日本弁理士意匠委員会第1部会では最終的な結論には至っていないが、議論の過程において、無審査による寄託制度のような保護枠が一つの案として挙げられた。」

(4) 国内・海外の調査として、この調査委員会の議論に資することを目的に、訴訟経験のある国内のソフトウェアハウスにヒアリングをおこなっている。海外の調査では、米国及び欧州各国の制度とデザイン開発における調査がおこなわれており、まず米国に関しては、前述のとおり、広範囲な画像デザインが権利化されている。一方、欧州各国に関しては、すでに何件かのG U I が意匠登録されていたが、コンピュータ・アイコンの意匠登録性に関する文献や判例はほとんど存在せず、欧州諸国^(注7)の態度は「コンピュータ・アイコンに対し意匠保護を提供することは問題となるものでもないし、またコンピュータ・アイコンが意匠保護の対象から除外されてもいない」と考え得る、とまとめている。

(5) 意匠法による画像デザインの保護の在り方については、画像デザインの創作に意匠法の保護を与えることが、創作の実態にも適し、法律制度としても自然というべきである、とまとめられており、その中で、意匠の定義に関する以下のような改正案（①又は②）が提示された。

① 意匠とは「物品に応用される形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」であると改める。

② 「物品の」は現行法どおりとし、「物品」を「物品（物品の部分及び電磁的方法により表示画面

(注6) この報告書において、画像デザインに関する参考資料として以下の5つの報告書などが紹介されている。

- (※1) 特許庁審査業務部意匠課・意匠審査基準室『意匠登録出願の願書及び図面の記載に関するガイドライン—基本編— 液晶表示等に関するガイドライン〔部分意匠対応版〕』（特許庁，2002）
- (※2) (財)知的財産研究所『意匠に係る物品と意匠保護のあり方に関する調査研究報告書』（(財)知的財産研究所，1995）
- (※3) 特許庁・意匠制度ラウンドテーブル報告書『魅力ある意匠制度の確立へ向けて』（特許庁，1995.8.22）
- (※4) (財)知的財産研究所『デザイン活動の実態に合致した意匠保護のあり方に関する調査研究報告書』（(財)知的財産研究所，1996）
- (※5) (社)日本デザイン保護協会意匠制度検討特別委員会『国際化時代に対応した創造的デザインの保護強化報告書』（(社)日本デザイン保護協会，1997）
- (※6) (社)日本デザイン保護協会『操作画面デザインの部分意匠保護に関する調査研究報告書』（(社)日本デザイン保護協会，2001）

(注7) ただし、英国だけは注目すべき例外で、英国においてはアイコンその他のG U I 要素は物品性を備えているとは認められず、当時の英国登録意匠法に基づく保護を受けることはできなかった。

等に表示される図形等を含む。)」とする。

これらを踏まえ、最後に「本委員会では、このような様々な問題について調査研究を行ったが、最大の問題である（意匠の）物品性の要件について多くの議論を行った。そこでは、この要件は、意匠の成立要件として規定されてはいるが、本来は、権利の範囲の関係から生じたものであって、意匠自体の性質から要請されるものではない、よって緩やかに解することが可能であるとの指摘がなされた。さらに、意匠と物品との関係を緩和する、あるいは意匠を物品と切り離して捉えるといった立法論の提案も行われた。」とまとめられている。

(2) デザインの戦略的活用に応じた意匠制度の在り方に関する調査研究委員会（平成 15 年）

・ 開催の趣旨

近年、中国をはじめとするアジア諸国の生産技術が向上しており、我が国においては、国際的な産業競争力を確保し、経済・社会全体の活性化を図ることが喫緊の課題となっている。このような状況に対し、戦略的なデザインの活用は効果的であると考えられていた。また、「知的財産戦略大綱」や「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」においても「意匠制度の在り方に関する検討」、「ネットワーク上で利用される操作画面（アイコン等）に関する検討」が求められているところであった。こうした状況から、デザイン活動に対するインセンティブを与え、我が国の産業競争力を強化する意味で、デザイン活動の成果を適正に保護する仕組みを見直すべき時期を迎えているものと考えられ、デザインの戦略的活用に応じた形での意匠制度の在り方について早急に検討を開始する必要がある。

そこで、委員長を牧野利秋 ユアサハラ法律特許事務所弁護士・弁理士 として、本委員会が組織された。

・ 報告の概要

① 画面デザインの保護に関する検討

画面デザインに関して、物品性を前提とする既存の制度的枠組みに不要な混乱を生じさせることのないように制度設計をおこなう、といった基本的な前提のもと、検討がなされた。

はじめに、事務局（財団法人知的財産研究所）から、「現行意匠法に基づく物品についての考え方を踏襲して、市場で流通し、一定の経済的価値を有するプログラムを一つの製品と捉え、そのプログラムに係る視覚的要素を保護対象とし、「差止等の措置の対象は、意匠権に係るプログラム等とする。」案が提示された。

それに対し、画面デザインを保護する仕組みを設けることには賛成するものの、事務局案では、プログラムそのものまで差し止める保護手段が強力になり過ぎるとの指摘があった。

検討の結果、従来、保護対象となっていなかった「機器と一体性のない画面デザイン」についても、産業活動に係る知的財産として、意匠法による保護の在り方を検討していく必要性が十分にあることが確認された。だが、具体的な制度の仕組みの提示には至らなかった。

② 意匠権の効力範囲の拡大に関する検討

企業が、独自性や独創性のあるデザイン開発を重視するようになり、魅力的な商品を産み出していくことが期待されていた現状を踏まえ、当時の意匠制度の枠組みにとらわれないデザイン保護の本質に即した意匠制度の在り方、特に、意匠権の効力範囲の拡大に関して、幅広い議論がおこなわれた。

まず、意匠権の効力範囲の拡大に関し、以下の検討課題 7 つを挙げ、それぞれに議論をおこない、

どのような検討が必要であるかをまとめている。

- 1) 創作の背景にある思想等を含めた保護
- 2) 独創性の高い意匠の保護
- 3) 模様、色彩、材質、質感等の特徴を中心とした保護
- 4) 登録意匠に係る物品とは非類似の物品への転用の保護
- 5) 創作の価値と誤認混同
- 6) 絶対的独占権と相対的独占権
- 7) 意匠の類似を判断する手法や基準の明確化

次に、開発プロセスの時系列に沿って産み出される知的成果物を以下のように分類化し、その分類化された知的成果物を当時の意匠制度の保護の枠組みに擬似的に当てはめるとどのような問題点が生じるか、といった検証がなされた。

このとき、分類化された知的成果物（「まとまり」という語句が用いられている。）は次のとおりである。

- 1) (当時の) 意匠法の保護対象より上流のプロセスにおける知的成果物
 - ・製品、商品開発のコンセプトを示すまとまり
 - ・新規な機能や用途を実現するための構成によるまとまり
 - ・新規に創作された部分のまとまり
 - ・創作した意匠が当業者にとって容易に創作することができる範囲も含むまとまり
- 2) 製品、商品の完成時に位置する知的成果物
 - ・抽象化された美感のまとまり
- 3) (当時の) 意匠法の保護対象より下流のプロセスにおける知的成果物
 - ・自他識別力を表す記号となるまとまり

これらに対する検証の結果として、1) 上流プロセスの成果物の保護に関しては、特許法・実用新案法との保護領域重複の問題、意匠権の過度の強化による競争制限などが生じる、といった問題点が抽出されている。また、2) 製品・商品の完成時に位置する知的成果物として抽象化された美感のまとまりを保護する事に関しては、意匠権の効力範囲の外延が現行制度より曖昧になるおそれがあると指摘され、3) 下流プロセスにおける成果物の保護に関しては、既に商標法、不正競争防止法などで保護されている領域と重複するところも多く、意匠法での保護の必要性があるのか検討が必要とされている。

③ その他の検討課題

その他に、デザインを保護している意匠法以外の知的財産権法と意匠法、諸外国の意匠制度と我が国の意匠制度などを比較し、今後の意匠制度の見直しの際に橋渡しとなるような指摘や課題の提示がなされた。

(3) 独創的なデザインの保護に即した意匠制度の在り方に関する調査研究委員会（平成 17 年）

・ 開催の趣旨

この調査研究委員会による調査研究は、当時開催中であった意匠制度小委員会における検討に資するものとなることを目的とし、この調査研究がおこなわれる前に開催された意匠制度小委員会の第4回（平成16年12月17日）までの議論を踏まえ、デザインを保護する制度の中核をなす意匠制度の在り方に関して、意匠権の効力、意匠登録制度、意匠の保護対象などの具体的検討事項の法制

面からみた精査をおこなった。委員長は、大淵哲也 東京大学法学部・大学院 法学政治学研究科教授 であった。

・ 報告の概要

本報告書では、以下の項目に関して、それぞれ「問題の所存」、「検討の内容」、「対応の方向」がまとめられた。

- 1) 無審査登録制度の導入によるダブルトラック化
- 2) 画面デザインの保護
- 3) 意匠権の効力範囲の拡大
- 4) 意匠権の物品間の転用までの拡張
- 5) 意匠権の効力範囲の明確化
- 6) 税関における部品の取外し
- 7) 権利侵害行為への「譲渡等を目的とした所持」の追加
- 8) 権利侵害行為への「輸出」「通過」の追加
- 9) 意匠権の存続期間の延長
- 10) 刑事罰の強化
- 11) 関連意匠制度の見直し
- 12) 先願意匠の一部と同一又は類似の後願の意匠
- 13) 新規性喪失の例外規定
- 14) 秘密意匠制度
- 15) 先行意匠開示制度

これら検討項目のうち、1) 無審査登録制度の導入によるダブルトラック化、に関しては、無審査制度のモデルケース（①実用新案法型、②審査請求型、③半導体集積回路法型、④著作権法型）などの検討をおこない、産業界のニーズや他法（不正競争防止法など）によるデザイン保護の状況等を踏まえ、慎重な検討が必要であると結論付けている。

また、3) 意匠権の効力範囲の拡大、については実効性の観点から、15) 先行意匠開示制度、については、その効果と出願人負担のコストバランスから、慎重な検討が必要であると結論付けた。

次節で紹介するように、これらの項目は、最終的に改正には至らなかった。また、本報告書で具体的な対応策が示された項目のうち、4) 意匠権の物品間の転用までの拡張、に関しても、後の意匠制度小委員会での議論の結果、改正までには至らなかった。

第3節 意匠制度小委員会

1 意匠制度小委員会の設置

意匠制度小委員会は、知的財産戦略会議において決定された「知的財産戦略大綱」及び「知的財産推進計画 2004」の具体的実施に向け、魅力あるデザインを創造し、より価値の高い製品を提供する環境を整備するために、意匠制度の全般的な在り方について広範に検討し、2005年度までに結論を得るために、平成16年7月、産業構造審議会知的財産部会の下に設置された。^(注8)

平成16年に4回の委員会が開催され、中間的な論点がまとめられた。この中間整理を踏まえ、知的

(注8) 参考資料 産業構造審議会 第6回知財部会 資料4-1「意匠制度小委員会について」

財産研究所により「独創的なデザインの保護に即した意匠制度の在り方」に関する調査研究がおこなわれ、意匠制度小委員会の法改正に向けた議論に資する事を目的とした報告書がまとめられた。

全10回（中間整理以前も含む）の会合を開催し、多数の検討項目について審議をおこない、意匠制度小委員会により、報告書『意匠制度の在り方について』がまとめられた。この報告書は、平成18年2月15日に開催された「産業構造審議会 第7回知的財産政策部会」（中山信弘 部会長）に提出され、事務局の説明の後、同部会の報告書とする事が了承された。

2 開催概要

- 第1回：平成16年9月15日 「意匠制度の見直しに関する検討の視点」
- 第2回：平成16年10月15日 「意匠制度の枠組みの在り方について」
- 第3回：平成16年11月17日 「意匠の登録要件と効力範囲の在り方について」
- 第4回：平成16年12月17日 「中間的な論点の整理（案）について」
「損害賠償制度の強化について」
「刑事罰の強化について」
「税関における意匠侵害物品の部品外しについて」
- 第5回：平成17年9月27日 「意匠権の効力範囲の拡大について」
「意匠制度の枠組みの在り方について」
「意匠権の強化について」
- 第6回：平成17年10月14日 「意匠権の保護対象の拡大について」
「意匠登録手続の見直し、利便性の向上について」
- 第7回：平成17年11月7日 「意匠制度の在り方（論点整理）について」
- 第8回：平成17年12月5日 「意匠制度の在り方（論点整理）について」
- 第9回：平成17年12月20日 「意匠制度の在り方について」（報告書案）
平成17年12月28日～平成18年1月20日 「意匠制度の在り方について」（報告書案）に対する意見募集
- 第10回：平成18年1月25日 「意匠制度の在り方について」（報告書案）

3 構成メンバー

- 委員長 大 淵 哲 也 東京大学法学部・大学院法学政治学研究科 教授
- 委員 岡 崎 秀 正 日本知的財産協会 常務理事
株式会社神戸製鋼所 理事 知的財産部長
- 勝 尾 岳 彦 日経BP社 日経デザイン編集長
- 菅 井 孝 社団法人日本自動車工業会 知的財産部会部会長
本田技研工業株式会社 知的財産部企画室長
- 茶 園 成 樹 大阪大学大学院高等司法研究科 教授
- 平 野 哲 行 日本デザイン事業協同組合 理事長
株式会社平野デザイン設計 代表取締役社長
- 牧 野 利 秋 ユアサハラ法律特許事務所 弁護士・弁理士
(元東京高等裁判所判事)

水谷直樹	水谷法律特許事務所 弁護士・弁理士
光主清範	社団法人電子情報技術産業協会 法務・知的財産権総合委員会委員長 株式会社東芝 知的財産部知的財産渉外部担当部長
峯唯夫	日本弁理士会 執行補佐役（前副会長）
森山明子	武蔵野美術大学造形学部デザイン情報学科 教授
山本建太郎	京都工芸繊維大学工芸学部 教授
山本為信	山本光学株式会社 代表取締役社長

（五十音順，敬称略）

4 報告書『意匠制度の在り方について』の概要

検討された項目は、知的財産研究所による『独創的なデザインの保護に即した意匠制度の在り方に関する調査研究報告書』の中で提示された15個の検討項目を踏まえており、最終的には、「権利期間の延長」、「刑事罰の強化」、「権利侵害行為への「輸出」の追加」、「権利侵害行為への「譲渡等を目的とした所持」の追加」、「意匠の類似の範囲の明確化」、「画面デザインへの保護対象の拡大」、「関連意匠制度の見直し」、「部品及び部分意匠の保護の在り方の見直し」、「秘密意匠制度の手続見直し」、「新規性喪失の例外の適用規定の手続見直し」の10項目に関して、具体的な改正案が報告としてまとめられた。

一方、「税関における部品の取り外し」、「意匠権の物品間の転用までの拡張」、「無審査登録制度の導入によるダブルトラック化」に関しては、更なる検討が必要であるとされ、平成18年の意匠法改正には至っていない。

これら改正に至らなかった3項目に関する報告の概要は、以下のとおりである。

① 税関における部品の取り外し

輸入者が通関前に侵害疑義物品から部品等を取り外し、非侵害物品として通関した後に市場に流通している修理部品等を用いて復元し、侵害物品として販売する脱法的行為が可能となっている。

しかしながら、このような行為に対しては、現行法下でも意匠権者は、自己の意匠権を侵害するおそれがあるとして侵害の予防を請求することができること、また、当該行為を侵害とした場合、国内における未完成物品の製造や譲渡も要件を満たせば侵害行為となることから慎重な検討が必要であり、これらの行為を規制する必要性が生じた場合に、改めて、検討を行うことが適切である。

② 意匠権の物品間の転用までの拡張

強力な顧客吸引力や差別性を有する製品の形態を他の物品の形態として取り入れて模倣する事例があるとの指摘がされている。

しかしながら、デザインの転用行為を保護対象とすることは、意匠の創作という知的創作活動の保護を超え、そのデザインの信用や評価を保護することとなり、意匠法の制度趣旨と整合しない。また、登録意匠として特定された物品とは異なる物品分野からの不測の権利行使を受ける可能性も否定できないことから、慎重な検討が必要である。

③ 無審査登録制度の導入によるダブルトラック化

販売開始後の早い段階で模倣品が発生する商品等を扱う分野においては、現在の審査登録制度より早い期間で権利化できる制度の検討が必要である。

しかしながら、現在は、迅速・簡便な保護制度の導入よりも、安定した権利関係の構築が重視さ

れる環境にあり、無審査登録制度については、直ちに導入する環境にはないため、現在の審査登録制度を維持しつつ、今後、意匠データベースの整備といった意匠制度活用等の環境が整備され、審査運用での対応を超える早期保護への強い要請が生じた場合、改めて無審査登録制度導入の是非を検討する。

第4節 平成18年改正の主な内容

平成18年の意匠法の主な改正内容は、以下のとおりである。なお、審議室（特許庁総務部総務課制度改正審議室）による「産業財産権法（工業所有権法）の解説」を参考とした。

1 意匠権の強化

(1) 権利期間の延長

従来、意匠権の存続期間は、設定登録の日から15年をもって終了するとされていた（昭和34年改正により、10年から15年へと延長された。）。国際的には、TRIPS協定において「意匠権の登録期間は少なくとも10年」とされているのみであり、それぞれの国の実情等に応じて、権利の存続期間が各国ごとに設定されている（米国：登録から14年、欧州主要国：出願から5年その後最長25年間まで延長可能。）。ところで、消費動向を見ると、デザインによる製品の差別化が求められていることから、我が国企業においても今まで以上にデザイン開発が重視されるようになっており、魅力あるデザインは商品の価値の長期的な維持に重要であると認識されていた。実際、意匠権の存続期間満了年である15年目における現存率は約16%と比較的高い数字となっていた。こうしたことから、意匠権の存続期間を延長する必要性が高まり、意匠権の存続期間を「設定登録の日から15年」から「設定登録の日から20年」へと改めた（意匠法21条）。

(2) 刑事罰の強化

意匠権侵害に対する抑止効果を高めるため、意匠権侵害罪に係る刑事罰を厳格化する必要がある。意匠権侵害罪に係る刑事罰を「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」から「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」に引き上げた（意匠法69条の2）。また、懲役刑と罰金刑の併科を設け、意匠権侵害罪の法人重課について、3億円以下の罰金に引き上げた（意匠法74条）。

2 意匠権の効力範囲の拡大

(1) 権利侵害への「輸出」の追加

模倣品・海賊版が世界各国に拡散している情勢のもと、意匠権者の製造や譲渡等を独占的に行う経済的利益を適切に保護するためには、「輸出」を侵害行為に追加することが必要である。また、国内における侵害行為を抑止し、水際において侵害物品の取締りを実効的に行う観点からも、「輸出」を侵害行為に追加する必要がある。これらの理由により、実施・使用の定義規定に輸出する行為を追加した（意匠法2条3項）。あわせて、輸出の前段階である侵害物品の「輸出のために所持する行為」を「侵害とみなす行為」として追加した（意匠法38条2号）。

(2) 権利侵害行為への「譲渡を目的とした所持」の追加

偽ブランド品などの模倣品による侵害行為が組織化・巧妙化し、市場における取引の最終局面である個々の譲渡等の場面のみを意匠権侵害行為として押さえるだけでは、模倣品の取締において十分な効果が発揮できない状況となっていた。このため、意匠権による保護の実効性を担保するためには、市場において広く譲渡される前段階である所持行為に対し意匠権の効力を及ぼす必要があり、前記「輸出」とともに、「譲渡、貸渡し」を目的とした所持を侵害行為として追加した（意匠法 38 条 2 号）。

(3) 意匠の類似範囲の明確化

意匠の登録要件のうち新規性（意匠法 3 条 1 項 3 号）や先願（同 9 条）などの判断において、及び、意匠権の効力範囲（同 23 条）の判断において、意匠の類似の判断が重要な役割を担うものとなっている。

新規性の判断は、最高裁判例上、「一般需要者の視点から見た美感の類否」を判断するものとされているが^(注9)、裁判例や実務の一部においては、意匠の類似についてデザイナー等の当業者の視点から評価を行うものもあり、最高裁判例とは異なる判断手法をとるものが混在していることにより意匠の類否判断が不明瞭なものとなっていると指摘されていた。

意匠の類似の判断は、重要な概念であることから、統一性をもって判断されることが望ましい。したがって、意匠の類否判断について明確化するために、「意匠登録とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする」（意匠法 24 条 2 項）と規定した。

なお、ここでいう需要者とは、取引者及び需要者を意味すると解される。また、この規定は、意匠法第 3 条第 1 項第 3 号をはじめ、他の条項に規定されている意匠の類否についても一定の解釈が及ぶことになるものと考えられた。

3 意匠の保護対象の拡大

(1) 意匠の定義の見直し（画面デザインの保護の拡充）

情報技術の進展や経済・社会の情報化を背景として、マンマシンインターフェースが、物理的なもの（操作ボタンなど）から電子的なもの（GUI など）へと移行しつつあり、電子的な画面上に表示された図形等から成るいわゆる「画面デザイン」を利用して操作をする機器が増加してきた。画面デザインは、家電機器等の品質や需要者の選択にとって大きな要素となり、企業においても画面デザインへの投資の重要性が増大した。

一方、従来の意匠制度においては、意匠法において規定されている物品について厳格な解釈をおこない、画面デザインの一部のみしか保護対象とされていなかった。

意匠法による保護の状況は、画面デザインの創作に大きな投資をしている企業等による製品開発の実情と合致しないものとなってきていることから、こうした画面デザインを意匠権により保護できるようにし、模倣被害を防止することの必要性が高まった。

このため、画面デザインに関して、以下のような改正がおこなわれた。

・物品の本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要となる操作に使用される画面デザイン(画

^(注9) 「意匠法三条一項三号は、意匠権の効力が、登録意匠に類似する意匠すなわち登録意匠にかかる物品と同一または類似の物品につき一般需要者に対して登録意匠と類似の美感を生ぜしめる意匠にも及ぶものとされている（法二三条）ところから、右のような物品の意匠について一般需要者の立場からみた美感の類否を問題とする」（最三小判昭 49 年 3 月 19 日民集 28 卷 2 号 308 頁）

像) について、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に含まれるものとして意匠法の保護対象とした。

- ・当該画面デザインがその物品の表示部に表示されている場合だけでなく、同時に使用される別の物品の表示部に表示される場合も保護対象とした。
- ・物品から独立して販売されているビジネスソフトやゲームソフト等をインストールすることで表示される画面デザインについては、保護対象となる画面デザインには含まないものとした。

具体的には、意匠の定義に次のような規定を追加した。「前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作（当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。）の用に供される画像であって、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。」（意匠法 2 条 2 項）

4 意匠制度の枠組みの在り方

(1) 関連意匠制度の見直し

平成 10 年意匠法の一部改正で、類似意匠制度に代わって関連意匠制度が導入された。その関連意匠制度では、同じデザイン・コンセプトから同時期に創作されたバリエーションを保護するという制度趣旨から、同日出願の場合に限り、関連意匠として意匠登録を受けることができた。しかし、開発当初の製品投入後に需要動向を見ながら追加的にデザイン・バリエーションを開発するなど、デザイン戦略がより機動化・多様化しつつあり、また、同日出願のみ関連意匠を認める制度下にあつては、開発当初の実施製品に係る意匠から先行して出願するなどの柔軟な出願方法に対応できないとの指摘があつた。

そこで、関連意匠について同日出願の場合のみ登録が認められていた制度を改め、本意匠の公報発行の前日までの間に出版された関連意匠について意匠登録を受けることができることとした（意匠法 10 条）。

(2) 意匠登録要件（意匠法 3 条の 2）の見直し

従来、意匠法第 3 条の 2 の規定により、全体意匠と当該全体意匠の一部と同一又は類似する意匠について意匠登録を受けようとする場合には、全体意匠の出願日以前に当該部分意匠又は部品の意匠を出願する必要があつた。しかし、デザイン開発の実態、需要を喚起する独自性の高い創作部分が模倣の対象となりやすい市場における実態、などを踏まえて、独自性の高い自己の製品デザインの保護を強化するために、意匠法第 3 条の 2 の規定を緩和した。

すなわち、先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠であっても、先願意匠の出願の日の翌日からその公報発行の日前までに同一出願人が出願した場合は、拒絶されないこととした（意匠法 3 条の 2）。

(3) 秘密意匠制度の見直し

審査の迅速化が実現したことに伴い、出願のタイミングによっては、商品の販売前にもかかわらず、意匠公報の発行によって意匠が公開されることがあり、商品の広告・販売戦略等に支障が出る場合が生じていた。このような場合、秘密意匠制度を利用することができるが、秘密意匠の請求は意匠登録出願と同時にしなければならないとされていたため、審査が出願時の予想よりも早期に終了した結果秘密意匠の請求の必要が生じたような事態には対処できなかった。こうしたことから、

審査が終了した後も秘密意匠の請求を可能とするため、秘密意匠の請求をすることができる時期的要件について、現行法において認められている、出願と同時にする場合に加え、意匠登録の第1年分の登録料の納付と同時にする場合も認めることと改めた（意匠法14条）。

(4) 新規性喪失例外の適用の手続の見直し

企業の製品開発の活発化や多様な情報媒体による情報流通環境の発展に伴い、出願前に自ら意匠を公開するケースが増加しており、意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために、意匠が公知の状態になったことについて第三者からの証明を取得することに要する手間と時間が負担となるので、提出書面の準備期間が不十分であるとの指摘があった。したがって、出願の日から14日以内とされている証明書の提出期間を、出願の日から30日以内とすることと改めた（意匠法4条）。

第5節 産業財産権法のその他の改正（平成11年～平成18年）

平成11年から平成18年までの産業財産権法の改正は、これまでの改正と同様に、権利付与の迅速化のための改正や、国際調和を目的とする改正がおこなわれた。また、情報技術の変革に伴う社会情勢へ対応するための改正もおこなわれた。

意匠法に関しては、平成11年に、「新規性阻却事由の拡大」（インターネット等の電気通信回線を通じて開示された意匠についても新規性阻却事由とした）（意匠法3条1項2号）、「新規性喪失の例外適用の運用対象の拡大」（公開意匠と出願意匠との同一性要件を廃し、新規性喪失例外適用を受ける意匠を、新規性、創作非容易性の判断のもととしない制度と改めた）（意匠法4条）などの項目が改正された。

一方、意匠法以外を主な改正項目とするものでは、平成11年に、特許法において「審査請求期間の短縮」がおこなわれ、商標制度においては、マドリッド協定議定書の承認及び加入に伴う大幅な制度改正がおこなわれた。

平成14年の法改正では、「発明の実施の定義の見直し」、「先行技術文献開示制度の導入」などがおこなわれた。「発明の実施の定義の見直し」により、特許法上の「物」に「プログラム等」が含まれることが明確になったが、意匠法の「物品」の定義に関しては改正がおこなわれなかった。ただし、意匠法の間接侵害規定における意匠に係る物品の製造に用いる「物」には制御プログラム等が含まれ得るため、対応する条文の改正がおこなわれている（意匠法37条、38条）。

続く、平成15年は、制度改正の趣旨に「知的財産戦略本部」の文言が初めて記載されたことが注目される。この年は、「異議申立制度の廃止」など、迅速かつ適確な紛争処理制度の実現に向けた改正がおこなわれた。

平成16年には、特許法の「職務発明規定の見直し」がおこなわれ、それに伴い、意匠の職務創作規定についても同様の見直しがなされた（意匠法15条3項で準用する特許法35条）。また、無効理由が存在する特許権の行使に関する司法・行政の判断に関する問題に対処するために、「特許権者の権利行使の制限」が規定された（意匠法41条で準用する特許法104条の3）。

平成17年、地域ブランドの保護を目的として、商標制度に新たに地域団体商標制度が設けられた。

平成18年の意匠法の改正と同時に、特許法においては「シフト補正の禁止」、商標法においては「小売の役務商標制度の導入」などが改められた。

参考文献 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第17版）』（発明協会，2008年）
『特技懇 250号』（特許庁技術懇話会，2008年）

参考Webサイト 特許庁「産業財産権法（工業所有権法）の解説」
http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/sangyou_zaisanhou.htm

第6節 審査処理のための諸政策

1 意匠ペーパーレス計画

特許庁では、出願から審査、特許等の権利化情報までを電子化して特許庁内外の業務の効率化を図るものとして、1984年よりペーパーレス計画を推進してきた。意匠においても、(1) 審査事務効率の向上、(2) 資料整備負担の軽減と資料保管スペースの削減、(3) 意匠登録出願事務の効率化、(4) 意匠情報サービスの充実を目的として、「意匠審査事務機械化基本計画」を作成し、ペーパーレスシステムの開発に着手した。

1985年には、意匠検索システムの開発に着手し、意匠図面の画像処理技術の開発や機械化における検索記号(意匠FAセットターム/Dターム)の開発を推し進めた。その結果、1993年には、産業機器分室が機械化に移行し、その後、各審査室が順次機械化され、1998年には全審査室が機械化されることとなった。

また、1996年には、「ペーパーレス計画の今後のあり方」が決定され、これに基づき、総合意匠システムの分散処理移行や意匠出願の電子化等が推し進められ、平成12年1月より意匠電子出願サービスが開始された。

2 意匠登録1年化計画(略称「DR1計画」)

DR1計画は、意匠保護の一層の早期化の要請に応えるため、意匠登録出願から権利発生(意匠権の設定登録)までの期間を、平均で1年程度にするための意匠審査処理に関する実行計画であり、1989年に策定された。意匠審査部門において、ペーパーレス計画をはじめとして審査処理の迅速・的確化のための諸施策を推進していたが、早急に一層の審査処理促進策が必要との認識から、主として運用面における新たな施策を加え、総合して推進することとしたものである。

DR1計画として、①年2サイクル審査の導入や、②資料調査員の活用等による審査の効率化を図ることで、意匠審査においては、着実に審査期間の短縮が進んでいった。2002年における平均ファーストアクション(FA)期間は8.4か月、セカンドアクション(SA)期間は14.2か月に達し、さらに、2002年度末には、10年以上にわたる関連諸施策への取組の成果として、9割以上の案件について出願から1年以内の意匠登録(DR1)を達成することができた。

その後も、製品サイクルの短縮化、活発な技術革新、消費者側の商品デザイン性の重視、アジア諸国等からの模倣品流入の増加等、意匠の早期保護に対するニーズが高まる中、意匠審査の迅速化は進み、2005年には、FA期間は約7か月、SA期間も11.6か月に達した。

3 早期審査制度

意匠出願に関する早期審査制度は、1987年に導入されたものであり、所定の要件を満たす意匠登録出願については、速やかに審査を進めるものである。具体的には、①権利化について緊急性を要する実施関連出願(出願人等が、その出願の意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めている意匠登録出願であって、権利化に緊急性を要するもの)又は②外国関連出願(出願人がその出願の意匠について外国へも出願しているもの)という、要件を備えた意匠登録出願を早期審査の対象とする。

また、2005年4月からは、出願中の案件に関し模倣品が発生したときは、1ヶ月以内に一次審査結果を通知する新運用も開始した。

4 意匠審査における判断内容の明確化等

2004年より、拒絶理由の一部（意9条）について判断理由を付記する運用を開始した。さらに、2007年度は、さらに広げ、意匠法第3条1項3号（新規性）に該当する場合についても、類否判断の理由を記載した。

2006年度より、審査内容に関連した以下の情報提供を開始した。

①登録意匠公報に掲載している参考文献掲載情報の拡充

新規性、創作性を判断するうえで参考とした文献を「参考文献」として公報掲載していたが、出願人等による文献の原本の閲覧を容易にするために、意匠課公知資料番号も掲載を開始した。

②特許電子図書館（IPDL）での意匠関連情報の提供

1999年にインターネットを通じて産業財産権情報を無料で提供する「特許電子図書館」サービスを開始しており、意匠登録公報もインターネットを通じて検索することが可能となった。2006年3月には、特許庁の保有するデザイン関連情報の外部提供の一環として、公知資料番号によって公知資料の書誌的事項を照会できる「意匠公知資料照会」サービスを開始し、2007年度からは、特許庁が電子化する意匠公知資料を対象として著作物利用許諾を得る事業を開始した。

5 日本意匠分類の改正（2003年）

日本意匠分類は、昭和58年に策定されて以来20年以上経過しており、その間に生活スタイルや環境に合わせた製品が創造されデザインが多様化していること、また、平成10年に改正意匠法が導入されたことから、見直す時期にきていた。加えて、FA期間を平均7.5月（2004年）まで短縮し迅速化しているものの、模倣されやすい製品やライフサイクルの短い製品の産業分野からは更なる審査期間の短縮化が求められており、増大化する審査資料を効率よくサーチしていく必要があった。

そこで、日本意匠分類を改訂し、機械化における検索記号（意匠FAセットターム/Dターム）も取り込んだ、新たな「日本意匠分類 [平成17年1月1日施行版]」の適用を開始した。

6 意匠に関する国際動向と取り組み

各国毎に異なる意匠保護制度があるという状況は、我が国企業にとっても大きな負担である。各国との調和を図るため、躍進する中国、韓国、及び欧米諸国と意匠審査に関する会合が開催された。

(1) 海外知的財産権庁との会合

①日中審判会合（意匠）

2005年8月に日本で第1回日中審判会合（意匠）を開催した。2008年の第3回会合では、中国での専利法（日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当）の改正を踏まえた意見交換が行われた。

②日韓意匠審査官会合

2001年に第1回日韓意匠審査官会合を開催し、以来、毎年1回開催した。

③日欧意匠審査官会合

2003年に第1回日欧意匠審査官会合を開催した。

(2) アジア地域への協力支援

我が国産業界の関心の高い中国をはじめとして、アジア地域の国々との関係を深めるための専門家の派遣、研修生の受入といった途上国協力を毎年行った。

(3) 国際協定への対応

①ヘーグ協定

ヘーグ協定は、意匠の登録・寄託に関する国際的制度を構築する条約であり、出願受付、方式審査、公開、登録簿の作成・維持管理等といった各国に共通な手続を WIPO(世界知的所有権機関)の国際事務局が一元化して行うことにより、複数国において意匠登録を行う際に必要となる手続の簡素化及びそれにより生じる経費の節減効果を目的としている。

1999年ヘーグ協定ジュネーブ・アクトは、これまで欧州諸国が中心であったヘーグ協定加盟国の更なる拡大を目指して同年7月に採択された新アクト(改正条約)であり、現在の加盟国は26か国である。2003年12月23日に発効し、2004年4月1日にヘーグ協定全アクトに基づく共通規則及び新実施細則が施行され、ヘーグ協定ジュネーブ・アクトに基づく国際登録が開始された。

我が国は、ヘーグ協定ジュネーブ・アクトに関し、ヘーグ協定ジュネーブ・アクトに加盟した欧州共同体における利用状況やその他の主要国(米国、中国等)の加盟の可能性や我が国産業界のニーズを踏まえつつ、我が国の加盟に関する詳細な調査分析を行ったが、加盟はしなかった。

②ロカルノ協定

ロカルノ協定は、1968年に締結された意匠の国際分類を制定する協定であり、2007年1月現在、EUを中心に48か国が加盟している。ロカルノ協定に基づく意匠の国際分類は32のクラスと223のサブクラスで構成され、各国知的財産権庁、WIPO国際事務局等により用いられている。

我が国は、我が国意匠公報を審査資料とする途上国への協力や国際調和のためにロカルノ分類の併記を開始したが、ロカルノ協定には加盟しなかった。